Si 細線導波路とトポロジカル伝送路間の高効率な結合へ向けた トポロジカルテーパ構造の提案

Topological taper structure towards highly efficient coupling between Si wire waveguides and topological edge

state waveguide 各務 響¹, 雨宮 智宏^{1,2}, 岡田 祥¹, 齋藤 孝一¹, 田中 真琴¹, 西山 伸彦^{1,2}, 胡 暁³

°H. Kagami¹, T. Amemiya^{1,2}, S. Okada¹, K. Saito¹, M. Tanaka¹, N. Nishiyama^{1,2}, and X. Hu³

東京工業大学 工学院 電気電子系¹ 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所² 物質材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点³

¹Department of Electrical and Electronic Engineering, Tokyo Institute of Technology

² Institute of Innovative Research (IIR), Tokyo Institute of Technology

³WPI-MANA, National Institute for Materials Science

E-mail: <u>kagami.h.aa@m.titech.ac.jp</u>

1. はじめに

自明なフォトニック構造とトポロジカルなフォ トニック構造の界面に生じるトポロジカルエッジ 状態は、光通信において広く利用されている光回 路内において光渦の伝搬を可能とする[1,2]。しか しながら、一般的な光回路においては、その構成 要素の導波路型デバイス群が TE/TM モード光で のみ動作するため、光渦との親和性は決して高く ない。

そのため、本研究では、通常の Si 細線導波路とト ポロジカルエッジ伝送路間において高効率な結合を 可能とするトポロジカルテーパ構造の提案・解析を 行ったので、以下に詳細を述べる。

2. トポロジカルテーパの解析

理論解析に用いた素子構造を Fig. 1 に示す。本構 造では、TM モードから光渦モードに結合する際の モード不整合を抑制する目的から、トポロジカルテ ーパ構造を導入した。具体的には、Si 細線導波路か らトポロジカルエッジ伝送路に結合させる際、導波 路両側を自明/トポロジカルなフォトニック構造で 徐々に狭めていく構造を採用した。このとき、導波 路両側のフォトニック構造の非対称性により、入射 TM モードの等位相面がずれていくことで、トポロ ジカルエッジ伝送路の光渦モードに高効率に結合す る。解析においては、テーパ角度のおよびテーパ長*l* をパラメータとした。

Fig. 2 は、 θ = 30°, l = 5.4µmの場合の素子全体お よびテーパ近傍の磁界分布H_yを示しており、Si 導波 路内を伝搬する TM モードの等位相面が徐々にずれ ていくことで、効率的な結合が得られていることを 確認した。

Fig. 3 は各パラメータ設計値における出力強度を 比較したものである。これにより、 θ が小さく、lが 長い場合に出力強度が大きくなる傾向が見られ、計 算した範囲では、構造 C(θ = 30°, l = 5.4µm)におけ る結合効率 88.2%(損失値: 0.27dB/taper)が最高効率 となった。

謝辞

本研究は、JST CREST (JPMJCR18T4, JPMJCR15N6), JSPS 科研費 (#17H03247, #19H02193)の援助により行われた。











Fig. 3. Calculated output intensity with different device dimensions.

参考文献

[1] L.-H. Wu and X. Hu, *Phys. Rev. Lett.* **114**, 223901 (2015).

[2] A. B. Khanikaev *et al.*, Nature Photon. **11**, 763 (2017).